

# ستز مزوحفره SiC از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

زهرا سعیدی فر<sup>\*</sup>، امیر عباس نوربخش<sup>۲</sup>، روزبه جواد کلباسی<sup>۳</sup>، ابراهیم کرمیان<sup>۳</sup>

۱- کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

۳- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

<sup>\*</sup>Zahra.Saeedifar@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۱/۰۴/۱۱، تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۰/۰۲)

## چکیده

کاربید سیلیسیم مزوحفره با سطح ویژه بالا از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید، در محدوده دمایی  $550^{\circ}\text{C}$ - $600^{\circ}\text{C}$  با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال نانو کامپوزیت C / MCM-48 MCM-48 سنتز شد. نانو کامپوزیت SiC به روش پلیمریزاسیون درجا تهیه شد. خواص فیزیکی-شیمیایی و میکرو ساختاری پیش سازه و پودر SiC توسط تکنیک هایی همچون XRD، TEM، DSC- TGA و ایزوترم جذب/ واجذب نیتروژن مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد، پودر SiC حاصل به صورت مزوحفره و با سطح ویژه حدود  $330 \text{ m}^2/\text{g}$  می باشد. حضور پیک گرمaza در گراف DSC، نشان دهنده ای فرآیند خوداحتراق سنتز منیزیوترمال SiC می باشد. همچنین نتایج نشان داد، کربن علاوه بر تشکیل فاز SiC می تواند در احیای سیلیکا نیز نقش داشته باشد.

## واژه‌های کلیدی:

کاربید سیلیسیم، مزوحفره، احیای منیزیوترمال، پلیمریزاسیون درجا، نانو کامپوزیت.

## ۱- مقدمه

عنوان کاتالیزور ناهمگن مورد مصرف قرار می گیرد. بنابراین در سالیان اخیر سنتز SiC با سطح ویژه بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است[۱]. از طرف دیگر استفاده از مزوحفره<sup>۱</sup> سیلیکاتی منظم با حفراتی با اندازه ای بزرگ (۵۰ نانومتر)، مساحت سطح و حجم بالا و با توزیع باریک اندازه حفره به عنوان پیش سازه، مسیری مطمئن برای تولید SiC متخلخل با مساحت سطح ویژه بالا می باشد[۱-۲]. در میان مزوحفره ها، MCM-48 دارای

هدایت حرارتی بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون، استحکام مکانیکی و بی اثر بودن شیمیایی کاربید سیلیسیم، کاربردهای مختلفی را در زمینه های بیومتریال، دستگاه های نیمه رسانا در دمای بالا، کاتالیزورهایی با وزن سبک و استحکام بالا به آن ماده می دهد. به ویژه برای دیگر کاربردها، اگر بتوان این ماده را با مساحت سطح متوسط ( $20$  تا  $100 \text{ m}^2/\text{g}$ ) و توزیع مناسب اندازه منفذ بدست آورد، انتخابی مطمئن برای موادی می باشد که به

یکنواخت کربن و سیلیس در این روش، در طی فرآیند سنتر SiC، ساختار بهتر حفظ می‌شود. کلباسی و مصدق در سال ۲۰۱۱ سنتر نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی (۴-وینیل پریدین) را با استفاده از پلیمریزاسیون درجا مونومر های ۴-وینیل پریدین در داخل حفرات ۴۸ MCM انجام داده اند[۱۳].

در کار تحقیقاتی حاضر، فرآیند احیای منیزیوترمال برای سنتر مزوحفه SiC از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید در محدوده ۵۵۰-۶۰۰ °C (زیر نقطه ذوب منیزیم) گزارش شده است. سنتر نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید ناشی از پلیمریزاسیون درجای مونومر آلی اکریل آمید در حضور مزوحفه SiC در طی فرآیند احیای منیزیوترمال مورد بحث قرار می‌گیرد.

## ۲- مواد و روش تحقیق

### ۲-۱- سنتر مزوحفه MCM-48

۲/۴ گرم هگرا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB) در ۵۰ میلی لیتر آب دوبار تقطیر حل شد. به آن، ۵۰ میلی لیتر اتانول و ۱۲ میلی لیتر آمونیاک ۳۲٪ اضافه شد. محلول برای ۱۰ دقیقه هم زده شد. سپس ۳/۴ گرم تتراتیل ارتو سیلیکات (TEOS) اضافه و به مدت دو ساعت در دمای اتاق هم زده شد. بعد از صاف کردن و شستن با آب دو بار تقطیر، مواد حاصل در دمای اتاق خشک شد. سپس در دمای ۵۵۰ °C به مدت ۵ ساعت کلسینه گردید.

### ۲-۲- سنتر نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

۰/۵ گرم مزوحفه MCM-48 و ۰/۳۹۴۴ مونومر اکریل آمید و ۱۲ میلی لیتر تراهدروفوران در یک بالن ته گرد گذاشته شد. ۰/۰۴۰۳ گرم بنزوئیل پروکسید (۳٪ مولی) اضافه شد. محلول در ۷۰ °C حین همزدن تحت رفلaks به مدت ۵ ساعت در دمای ۶۵ حرارت داده شد. بعد از صاف کردن و شستن با تراهدرافوران، پودر سفید رنگ حاصل در دمای اتاق خشک

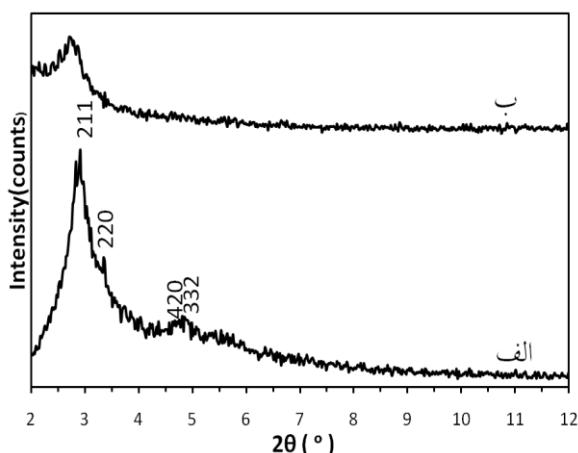
حرفه ای با نظم مکعبی و ساختار سه بعدی می‌باشد که مزیت بزرگی محسوب می‌شود. در واقع به علت ساختار سه بعدی حفرات این ماده، سطح درونی این ماده راحت‌تر در اختیار مولکول‌های میهمان قرار می‌گیرد و کم‌تر دچار گرفتگی حفرات می‌شود[۳-۲].

در حال حاضر روش‌های متعددی برای سنتر مزوحفه SiC از پیش سازه مزوحفه به کار می‌رود از جمله واکنش مستقیم سیلیکون با کربن مزوحفه در دماهای بالاتر از ۱۲۰۰ °C [۴-۵]، نفوذ پلیمر‌های preceramic (برای مثال پلی کربوسیلان‌ها) به مزوحفه سیلیکا و سپس پیرولیز به منظور سنتر مزوحفه SiC در محدوده دمای ۱۰۰۰-۱۴۰۰ °C [۶] و همچنین احیای کربوترمال سیلیکای مزوحفه در دمای حدود ۱۴۰۰ °C است[۷-۸]. در واقع به دلیل مشکل مربوط به کنترل رشد دقیق دانه‌ها و همچنین زیترینگ کاربید سیلیسیوم، ایجاد ساختار متخلخل از کربستال‌های SiC در دماهای بالا امری دشوار می‌باشد و در نتیجه ساختار‌های مزوحفه SiC نظم دار به خوبی شکل نمی‌گیرند[۹]. روشی دیگر برای سنتر مزوحفه SiC، تبدیل مستقیم نانو ساختار‌های کامپوزیت SiO<sub>2</sub>/C به مواد SiC مربوطه بدون از دست دادن مورفولوژی ساختار آنها با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال در دماهای پایین می‌باشد. در این روش احیای سیلیکا توسط منیزیم در دماهای کمتری صورت می‌گیرد[۱۰]. شی و همکاران، فرآیند احیای منیزیوترمال برای سنتر مواد نانو ساختار با استفاده از نانو کامپوزیت سیلیکا / کربن به عنوان پیش سازه و Mg به عنوان عامل احیا کننده را در ۶۰۰-۹۰۰ °C گزارش کرده اند[۱۰]. ژائو و همکاران مزوحفه‌ی کاربید سیلیسیوم را از طریق احیای منیزیوترمال کامپوزیت ۱۵-SBA / ساکاروز در دمای ۶۵۰ °C سنتر کرده اند[۹].

برای تهیه نانو کامپوزیت پلیمر / مزوحفه سیلیکاتی روش‌های مختلفی از جمله فرآیند سل-ژل، مخلوط سازی و پلیمریزاسیون درجا وجود دارد[۱۱-۱۲]. پلیمریزاسیون درجای مونومر در حضور حفرات مزوحفه روش بسیار مناسبی برای افزایش سطح تماس مزوحفه و کربن است. از طرف دیگر به دلیل توزیع

اشعه X از MCM-48 دارای دو پیک پراش مشخص مربوط به صفحات (۲۱۱) و (۰۰۲) در محدوده  $2\theta=30^\circ \sim 20^\circ$  و مجموعه پیک های پراش مربوط به صفحات (۰۴۰) و (۳۳۲) و ... در محدوده  $20^\circ \sim 5^\circ$  می باشد. وجود دوین پیک پراش به صورت مجزا در حدود  $5^\circ \sim 20^\circ$  نشان دهنده ی نوع بسیار منظمی از مزوحفه MCM-48 است. در واقع می توان گفت الگوی پراش اشعه X پیک هایی را شامل می شود که می تواند به گروه فضایی Ia3d و ساختار مکعبی منظم نسبت داده شود [۱۶-۱۴].

شکل ۱(ب) الگوی پراش اشعه X در زوایای کم از نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید نشان می دهد. وجود یک پیک پراش قوی مربوط به صفحه (۲۱۱) در  $20^\circ \sim 3^\circ$  نشان دهنده این است که با پلیمریزاسیون اکریل آمید در حضور MCM-48 ساختار مزوحفه تا حد زیادی حفظ گردیده است. کاهش در شدت پیک های نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید می تواند به کاهش نظم ساختار نسبت به ساختار میزان (MCM-48) نسبت داده شود [۱۳ و ۱۵].



شکل ۱(ا): الگوی پراش اشعه X در زوایای کم از (الف): MCM-48، (ب): نانو کامپوزیت ۴۸ / پلی اکریل آمید.

### ۲-۳-مشخصه یابی مخلوط نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید کربونیزه شده و منیزیم

شکل ۲ منحنی های DSC-TGA مخلوط پودری نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید کربونیزه شده و منیزیم را نشان می

گردید.

### ۲-۳-سترن $\beta$ -SiC

پودر نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید به منظور کربونیزه شدن در اتمسفر آرگون در دمای  $700^\circ C$  بازخ  $5^\circ C/min$  و زمان نگهداری ماکریم ۳ ساعت قرار گرفت. نانو کامپوزیت/C MCM-48/C (SiO<sub>2</sub>/C) حاصل با پودر منیزیم (با اندازه دانه ی کوچک تر از ۱mm و با فشار بخار  $13 hPa$  در  $325^\circ C$  با نسبت مولی SiO<sub>2</sub>:Mg=۱:۲ مخلوط شده و سپس در اتمسفر آرگون در محدوده ی دمایی  $550^\circ - 600^\circ C$  بازخ  $5^\circ C/min$  و زمان نگهداری در درجه حرارت ماکریم ۶ ساعت به منظور سترن  $\beta$ -SiC قرار گرفت. سپس پودر حاصل به منظور زدایش فازهای نامطلوب در مخلوطی از ۱۰ % وزنی HF و  $4 HNO_3$  مولار به مدت ۵ ساعت در دمای اتاق تحت عملیات اسید شویی همزده شد. سپس جهت استحصال کاربید سیلیسیوم مزوحفه، مخلوط حاصل صاف گردیده و با آب دوبار تقطیر شسته شده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق خشک گردید.

### ۴-مشخصه یابی

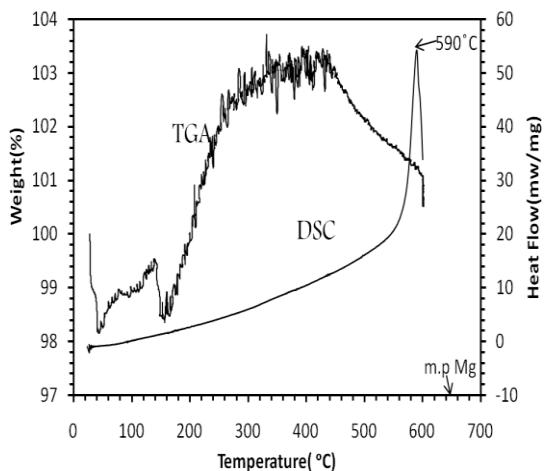
پیش سازه ی نانو کامپوزیت و SiC به دست آمده در دمای پایین توسط پراش اشعه X (مدل Philips PW3040- لامپ مسی - طول موج  $A=540.6 \text{ \AA}$  - فیلتر نیکل)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (EM10C مدل Zeiss(Germany))، ایزوترم جذب و واجذب نیتروژن (BEL Japan, Inc مدل Belsorp)، گرما سنجی افتراقی (Bähr-Thermoanalyse GmbH, Hüllhorst Germany، مدل DSC302) و آنالیز توزین حرارتی (کیمیای صنعت آرا مدل TG401) مشخصه یابی شدند.

### ۳-نتایج و بحث

#### ۳-۱-مشخصه یابی پیش سازه MCM-48 و نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید

شکل ۱(الف) الگوی پراش اشعه X در زوایای کم از مزوحفه MCM-48 بعد از کلسیناسیون را نشان می دهد الگوی پراش

$\text{C:SiO}_2:\text{Mg} = 1:1:2$  می تواند نشان دهنده ی کمبود کربن به دلیل شکل گیری گاز  $\text{CO}$  و خروج آن از محیط باشد<sup>[۲۰]</sup>. در این صورت می توان احتمال داد علاوه بر منیزیم، کربن هم در احیای سیلیس شرکت داشته و همچنین کاهش وزن حدود ۱۰ درصدی در نمونه ها بعد از عملیات حرارتی و عدم شناسایی کربن در الگوی پراش اشعه  $X$ ، احتمال مشارکت کربن در احیا و تولید گاز  $\text{CO}$  در حین فرآیند را افزایش می دهد. همچنین لازم به ذکر است احیای سیلیکا توسط منیزیم باعث تغییر در وزن نخواهد شد<sup>[۱۷]</sup>.

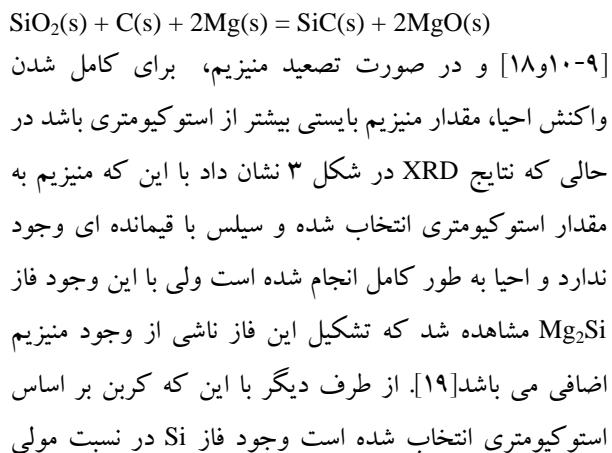


شکل (۲): منحنی های DSC-TG از مخلوط پودری نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید کربونیزه شده به همراه منیزیم با نسبت مولی  $\text{C:SiO}_2:\text{Mg} = 2:1:2$  با نرخ گرمایش  $5^\circ\text{C}/\text{Min}$  تا دمای  $600^\circ\text{C}$  و سپس حرارت دهی در همان دما به مدت  $30$  دقیقه در اتمسفر آرگون.

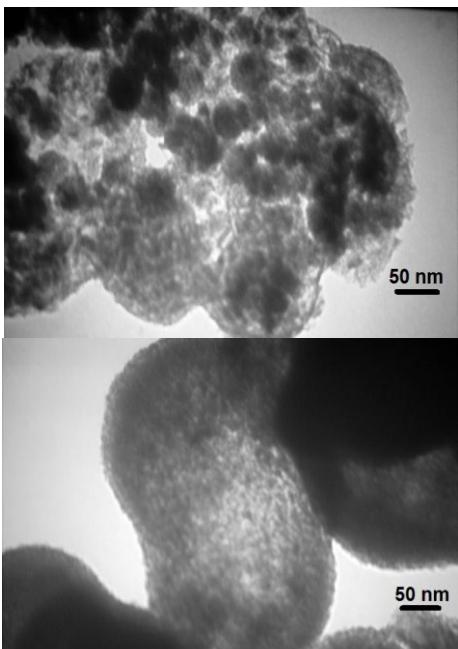
### ۳-۳-مشخصه یابی مزوحفره SiC

نانو کامپوزیت های MCM-48 / پلی اکریل آمید کربونیزه شده و منیزیم با نسبت های مولی مختلف (۲:۱:۲، ۲:۵:۱:۲، ۶:۱:۲:۱) در محدوده دمایی  $550-600^\circ\text{C}$  در شکل ۳ (الف) الگوی پراش اشعه  $X$  از نمونه های سنتر شده در محدوده دمایی  $550-600^\circ\text{C}$  قبل از اسید شویی را نشان می دهد. در هر سه نسبت مولی کربن، فاز- $\beta$ - $\text{SiC}$  مشاهده شد. با افزایش کربن محتوا، فاصله موجود بین  $\text{Mg}_2\text{Si}$  اضافی می باشد<sup>[۱۹]</sup>. از طرف دیگر با این که کربن بر اساس استوکیومتری انتخاب شده است وجود فاز  $\text{Si}$  در نسبت مولی  $\text{SiO}_2$  افزایش یافت. در نتیجه شدت پیک پراش مربوط به

دهد با توجه به نمودار DSC پیک گرمایی در محدوده دمایی  $590^\circ\text{C}$  زیر نقطه ذوب منیزیم ( $650^\circ\text{C}$ ) مشاهده شد که نشان دهنده ی احیای سیلیکا توسط منیزیم است<sup>[۱۷]</sup>. در واقع در این محدوده دمایی برهمکنش شیمیایی در محلول اولیه و تشکیل فاز  $\beta\text{-SiC}$  شروع می شود با توجه به نمودار TGA در محدوده دمایی زیر  $590^\circ\text{C}$  کاهش وزن حدود ۲٪ به دلیل خروج رطوبت از نمونه مشاهده شد. در محدوده دمایی  $300-350^\circ\text{C}$  افزایش وزن حدود ۵٪ مشاهده شد که می توان به سطح ویژه بسیار بالای MCM-48 / پلی اکریل آمید کربونیزه شده نسبت داد که تمایل زیادی در جذب گاز آرگون موجود در محیط دستگاه TGA دارد. در محدوده دمایی  $300-450^\circ\text{C}$  وزن ثابت می ماند که به دلیل پرشدن تمام حفرات نمونه از گاز آرگون است. همچنین در محدوده دمایی  $450-600^\circ\text{C}$  کاهش وزن حدود ۳٪ به دلیل متلاشی شدن ساختار مزوحفره (آغاز برهمکنش های شیمیایی بین اجزا) می باشد. شروع متلاشی شدن ساختار به شروع واکنش احیا نسبت داده می شود. بنابراین علاوه بر متلاشی شدن ساختار و خروج گاز آرگون احتمال دیگر کاهش وزن در این دما، همان تصعید منیزیم است. در صورت تصعید منیزیم در چنین دمایی، احیا توسط منیزیم واکنش جامد-گاز است که سریع تر از واکنش جامد-جامد است<sup>[۱۷]</sup> که تشکیل فاز  $\beta\text{-SiC}$  در چنین دمایی وجود این احتمال را بسیار افزایش می دهد. اما با توجه به واکنش:



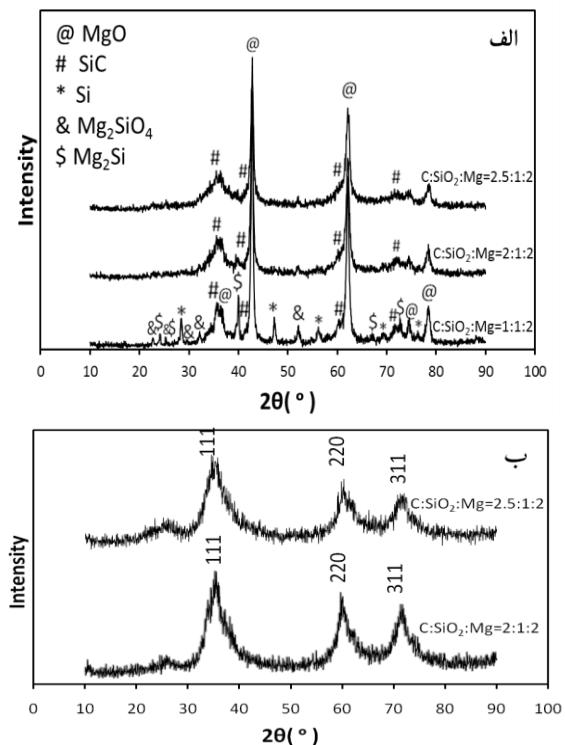
SiC با قطر متوسط حدود ۲۳۰ nm مشاهده شد. با استفاده از الگوی اشعه (شکل ۳ب)، متوسط اندازه کریستالیت های SiC از رابطه ی ویلیامسون - هال [۲۱] حدود ۱۸ نانومتر محاسبه شد. می توان دریافت که SiC حاصل دارای ساختار مشابه قالب مزوحفره ی ۴۸ MCM می باشد. هرچند نظم مزوحفره های SiC در مقایسه با قالب مزوحفره سیلیکا ضعیف شد. دلیل احتمالی، فعال بودن مزوحفره سیلیکا هم به عنوان قالب و هم به عنوان واکنشگر در طول فرآیند سنتر است که منجر به فرو ریختن بخشی از اسکلت مزوحفره سیلیکا می شود [۹].



شکل (۴): تصاویر TEM از مزوحفره SiC سنتر شده در محدوده دمای C ۵۵۰-۶۰۰.

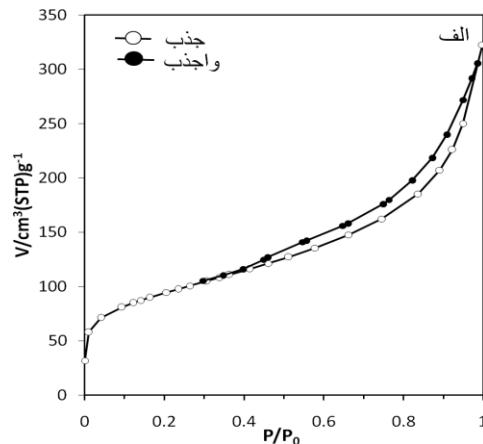
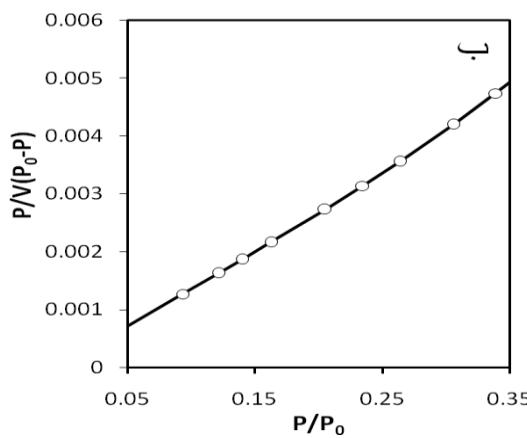
شکل ۵(الف) و (ب)، ایزوترم جذب / واجذب نیتروژن و BET-Plot از نمونه ی SiC را نشان می دهد ایزوترم جذب / واجذب نیتروژن از نمونه ی SiC، منحنی نوع IV را نشان می دهد که اشاره به مزوحفره بودن آن دارد. همچنین حلقه ی هیسترزیس H3 مزوحفره SiC، منحنی نوع H3 را نشان می دهد. منحنی نوع H3 هیچ محدودیتی در جذب در فشار های بالای p<sub>0</sub> را نشان نمی دهد [۲۲-۲۳]. در جدول ۱ اطلاعات حاصل از BET-Plot در نمونه ی SiC آورده شده است. SiC سنتر شده دارای سطح ویژه حدود ۳۳۰ m<sup>2</sup> g<sup>-۱</sup> می باشد.

فاز C-β-SiC کاهش یافت. در الگوی پراش اشعه X نمونه سنتر شده با نسبت مولی C:SiO<sub>2</sub>:Mg= ۱:۱:۲، پیک پراش نسبتاً شدید DSC- Si و Mg<sub>2</sub>Si مشاهده شد. همانطور که در منحنی های DSC- TGA مورد بررسی قرار گرفت کربن علاوه بر تشکیل فاز کاربید سیلیسیوم می تواند در احیای فاز سیلیکا نیز نقش داشته باشد. با افزایش نسبت مولی C:SiO<sub>2</sub>، پیک پراش Si و Mg<sub>2</sub>Si به تدریج ضعیف و ناپدید شد. شکل ۳ (ب) الگوی پراش اشعه X از نمونه های سنتر شده در محدوده دمایی ۰C-۶۰۰ بعد از اسید شویی را نشان می دهد. الگوی پراش اشعه X، پیک های مربوط به صفحات کریستالی (111)، (220) و (311) از C-β-SiC مکعبی را نشان می دهد. در الگوی پراش، هیچ پیک پراشی از فاز های Mg<sub>2</sub>Si، Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>، کربن و سیلیکا مشاهده نشد.



شکل (۳): الگوی پراش اشعه X از مزوحفره β-SiC سنتر شده در محدوده دمایی C ۵۵۰-۶۰۰ (الف): قبل از اسید شویی، (ب): بعد از اسید شویی.

شکل ۴ تصویر تهیه شده توسط TEM از مزوحفره SiC سنتر شده در محدوده دمایی ۰C ۵۵۰-۶۰۰ را نشان می دهد. ذرات



شکل (۵):(الف): ایزوترم جذب/واجدب نیتروژن از نمونه‌ی SiC (ب): BET-Plot از نمونه‌ی SiC

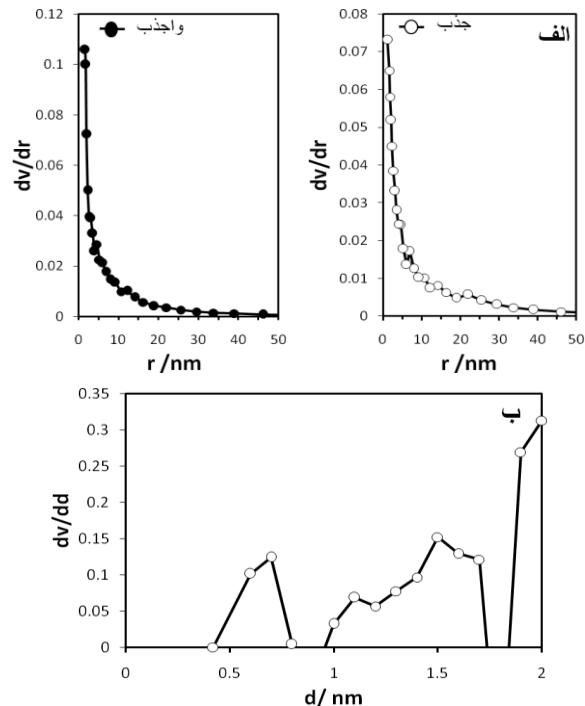
جدول (۱): اطلاعات حاصل از BET-Plot نمونه‌ی SiC

BET-Plot					نمونه	
$P/P_0 = ۰/۰۵ - ۰/۳۵$						
متوسط قطر حرفرا nm	حجم کلی حفرات ( $P/P_0 = ۰/۹۹$ ) $\text{cm}^3 \text{ g}^{-1}$	مساحت سطح ویژه BET ( $a_{S,BET}$ ) $\text{m}^2 \text{ g}^{-1}$	حجم گاز جذب شده در تک لایه ( $V_m$ ) $\text{cm}^3(\text{STP}) \text{ g}^{-1}$	ضریب ثابت (C)		
۵/۸۰۵۸	۰/۴۸۰۹	۳۳۱/۲۹	۷۶/۱۱۶	۲۸۹/۳۶	SiC	

شکل ۶ منحنی توزیع اندازه حفره از نمونه‌ی SiC در (الف) BJH-Plot و (ب) MP-plot را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد SiC ستز شده دارای توزیع اندازه‌ی حفره‌ی بسیار باریک در حدود ۲ nm می‌باشد. در جدول ۲ اطلاعات حاصل از BJH-Plot و در جدول ۳ اطلاعات حاصل از MP-plot در نمونه‌ی SiC آورده شده است.

جدول (۲): اطلاعات حاصل از BJH-Plot در نمونه‌ی SiC

BJH-Plot				نمونه	
BJH > ۲nm واجدب		BJH > ۲ nm جذب			
حجم مزوحفه $\text{cm}^3 \text{ g}^{-1}$	مساحت سطح مزوحفه $\text{m}^2 \text{ g}^{-1}$	حجم مزوحفه $\text{cm}^3 \text{ g}^{-1}$	مساحت سطح مزوحفه $\text{m}^2 \text{ g}^{-1}$		
۰/۳۸۱۹	۱۶۴/۷۳	۰/۴۱۵۰	۲۰۹/۳۷	SiC	



شکل (۶): منحنی توزیع اندازه حفره از نمونه‌ی SiC در (الف): BJH-Plot (جذب و واجدب)، (ب): MP-plot

عمل موینگ پوشش می دهد. از این رو با ذوب شدن سیلیکون، نفوذ کربن و Si سریع است. سپس واکنش سیلیکون با کربن (واکنش مایع- جامد) برای شکل گیری SiC مطابق رابطه (۲) انجام می شود. بنابراین می توان باور داشت که SiC و MgO به طور همزمان ستنر می شود[۱۸ و ۲۰].

حضور  $Mg_2SiO_4$  می تواند به دلیل واکنش های ناقص در فرآیند های سریع احترافی باشد[۱۸]. همچنین  $Mg_2Si$  توسط مازاد قابل توجهی از منیزیوم موجود برای واکنش، شکل گرفته می شود [۱۹]. دمای شروع واکنش توسط اندازه Mg احیا کننده تحت تاثیر قرار می گیرد. از آنجا که فشار بخار Mg بالاست تعجب آور نیست که Mg ریز دانه، واکنش را زیر نقطه ذوب آغاز کند. همچنین میزان کربن مورد استفاده، دمای شروع واکنش را تحت تاثیر قرار می دهد. از آن جایی که کربن، آغاز گر واکنش نمی باشد و در اوایل به عنوان ماده ای پر کننده عمل می نماید و فاصله موجود بین Mg و  $SiO_2$  را افزایش می دهد. بنابراین با افزایش کربن محتوا، دمای شروع واکنش افزایش می یابد.

#### ۴- نتیجه گیری

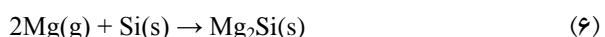
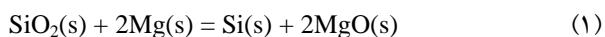
کاربید سیلیسیم ( $\beta$ -SiC) مزوحفه با سطح ویژه بالا از پیش سازه نانو کامپوزیت MCM-48 / پلی اکریل آمید، در محدوده دمایی  $600 - 550^{\circ}C$  (زیر نقطه ذوب منیزیم) با استفاده از فرآیند احیای منیزیوتermal نانو کامپوزیت  $SiO_2/C$  MCM-48/C ستنر شد. تصاویر TEM از SiC ستنر شده نشان داد SiC حاصل دارای ساختار مشابه قالب مزوحفه ای MCM-48 می باشد و نمودار هم دمای جذب و واجذب نیتروژن اشاره به مزوحفه بودن نمونه SiC ستنر شده دارد. کاهش دمای ستنر با استفاده از فرآیند منیزیوتermal نقش اساسی در حفظ ساختار SiC دارد. نتایج بررسی های DSC-TGA نشان داد احیای سیلیکا توسط منیزیم، آغازگر واکنش می باشد و حضور پیک گرمایی در گراف DSC نشان دهنده ای فرآیند خود احتراف ستنر منیزیوتermal کاربید سیلیسیم می باشد که نقش اساسی در تشکیل

جدول (۳): اطلاعات حاصل از MP-Plot در نمونه SiC.

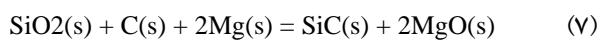
MP-Plot				نمونه
حجم میکروحفه $cm^3 g^{-1}$	مساحت سطح کل حفرات $m^2 g^{-1}$	مساحت سطح میکروحفه $m^2 g^{-1}$	مساحت سطح مزوحفه $m^2 g^{-1}$	
۰/۱۲۹۶	۳۵۳/۸۵	۲۰۶/۹۶	۱۵۱/۸۹	SiC

#### ۴-۴- مکانیزم پیشنهادی در ستنر SiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوتermal

در طی فرآیند ستنر، مخلوط  $SiO_2$ ، Mg و C ممکن است، فعل و انفعال داخلی داشته باشند. واکنش های شیمیایی واسطه به صورت زیر می تواند بیان گردد[۱۸ و ۲۰].



واکنش شیمیایی کلی به صورت زیر بیان می شود:



با توجه به منحنی های DSC-TGA پودر منیزیم در نزدیک دمای  $450^{\circ}C$  تضعید می شود. سیلیکا و کربن توسط منیزیم احاطه می شوند. به علت اینکه واکنش (۱) در میان واکنش های دیگر کمترین انرژی آزاد گیبس را دارد ابتدا سیلیکا مطابق رابطه (۱) توسط منیزیم احیا می شود که به همراه تشکیل MgO با آزاد شدن گرمای زیادی است. Si به دست آمده در اثر گرمای آزاد شده واکنش، ذوب شده و سیلیکون ذوب شده، کربن را توسط

- pp. 207–212, 2003.
- [8] Z.X. Yang, Y.D. Xia & R.Mokaya, "High surface area silicon carbide whiskers and nanotubes nanocast using mesoporous silica", *Chemistry of Materials*, Vol. 16, pp. 3877-3884, 2004.
- [9] B. Zhao, H. Zhang, H. Tao, Z. Tan, Zh. Jiao & M. Wu, "Low temperature synthesis of mesoporous silicon carbide via magnesiothermic reduction", *Materials Letters*, Vol. 65, pp. 1552–1555, 2011.
- [10] Y. Shi, F. Zhang, Y.S. Hu, X. Sun, Y. Zhang, H. I. Lee, L. D. Chen & G. Stucky, "Low-Temperature Pseudomorphic Transformation of Ordered Hierarchical Macro-mesoporous SiO<sub>2</sub>/C Nanocomposite to SiC via Magnesiothermic Reduction", *Journal of the American Chemical Society*, Vol. 132, pp. 5552–5553, 2010.
- [11] N. Hüsing, U. Schubert, "Porous Inorganic-Organic Hybrid Materials", *Functional Hybrid Materials*, Wiley-VCH, Weinheim, Vol. 4, pp. 86–121, 2003.
- [12] L. Wei, N. Hu & Y. Zhang, "Synthesis of Polymer-Mesoporous Silica Nanocomposites", *Materials*, Vol. 3, pp. 4066-4079, 2010.
- [13] R. JavadKalbasi, N. Mosaddegh, "Synthesis and characterization of Poly(4-vinylpyridine) / MCM-48 catalyst for one-pot synthesis of substituted 4H-chromenes", *catalysis communications*, Vol. 12, pp. 1231-1237, 2011.
- [14] S.E. Dapurkar, S.K. Badamali & Selvam P., "Nanosized metal oxides in the mesopores of MCM-41 and MCM-48 silicates", *Catalysis Today*, Vol. 68, pp. 63-68, 2001.
- [15] A.M. Doyle, E. Ahmed & B.K. Hodnett, "The evolution of phases during the synthesis of the organically modified catalyst support MCM-48", *Catalysis Today*, Vol. 116, pp. 50-55, 2006.
- [16] K. Wang, Y. Lin, M.A. Morris & J. D. Holmes, "Preparation of MCM-48 materials ith enhanced hydrothermal stability", *Journal of Materials Chemistry*, Vol. 16, pp. 4051-4057, 2006.
- [17] H.D. Banerjee, S. Sen, "Investigation on the Production of Silicon from Rice Husks by the Magnesium method", *Materials Science and Engineering*, Vol. 52, pp. 173-179, 1982.
- فاز  $\beta$ -SiC ایفا می کند. نتایج بررسی های DSC-TGA و وجود فاز نامطلوب Mg<sub>2</sub>Si در نتایج XRD و کاهش حدود ۱۰ درصدی وزن نمونه ها بعد از عملیات حرارتی، احتمال شرکت کربن فعال پیمری در کنار منیزیم در احیای سیلیکا را نشان داد. نتایج بررسی های XRD برای نسبت های مختلف کربن نشان داد با افزایش کربن محتوا، فاصله موجود بین Mg و SiO<sub>2</sub>  $\beta$ -SiC افزایش یافت و در نتیجه شدت پیک پراش مربوط به فاز  $\beta$ -SiC کاهش یافت.
- ## ۵- مراجع
- [1] J. Parmentier, J. Patarin, J. Dentzer & C. V.Guterl, "Formation of SiC via carbothermal reduction of a carbon-containing mesoporous MCM-48 silica phase: a new route to produce high surface area SiC", *Ceramics International*, Vol. 28, pp. 1-7, 2002.
  - [2] J. C. Vartuli, W.J. Roth, J.S. Beck, S.B. McCullen & C.T. Kresge, "The synthesis and properties of M41S and related mesoporous materials", *Molecular Sieves-Science and Technology*, Vol. 1, pp.97-119, 1998.
  - [3] R. Köhn, M. Fröba, "Nanoparticles of 3d transition metal oxides in mesoporous MCM-48 silica host structures: Synthesis and characterization", *Catalysis Today*, Vol.68, pp.227-226, 2001.
  - [4] Zh. Liu, W. Shen, W. Bu, H. Chen, Z. Hua, L. Zhang, L. Li, J.Shi & S.Tan, "Low- temperature formation of nanocrystalline  $\beta$ -SiC with high surface area and mesoporosity via reaction of mesoporous carbon and silicon powder", *Microporous Mesoporous Mater*, Vol.82, pp. 137–145, 2005.
  - [5] Y. Shi, Y. Wan & D. Zhao, "Ordered mesoporous non-oxide materials", *Chemical Society Review*, Vol. 40, pp. 3854–3878, 2011.
  - [6] Y.F. Shi, Y. Meng, D.H. Chen, S.J. Cheng, P. Chen, T.F. Yang, Y. Wan & D.Y. Zhao, "Highly ordered mesoporous silicon carbide ceramics with large surface areas and high stability", *Advanced Functional Materials*, Vol. 16, pp. 561-567, 2006.
  - [7] G.Q. Jin, X.Y. Guo, "Synthesis and characterization of mesoporous silicon carbide", *Microporous and Mesoporous Materials*, Vol. 60,

- [21] G. K. Williamson, W. H. Hall, "X-ray line broadening from filed Aluminium and Wolfram ",*Acta Metallurgica*, Vol. 1, pp. 22-31, 1953.
- [22] K. Kaneko, "Determination of pore size and pore size distribution1. Adsorbents and catalysts", *Journal of Membrane Science*, Vol. 96, pp. 59-89, 1994.
- [23] K. S. W. Sing, D. H. Everett, R. Haul, L. Moscou, R. A. Pierotti, J. Rouquerol & T. Siemieniewska, "Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity", *Pure and Applied Chemistry*, Vol. 54, pp. 2201-2218, 1982.
- [18] S. Niyomwas, "In Situ Synthesis of Silicon–Silicon Carbide Composites from SiO<sub>2</sub>–C–Mg System via Self\_Propagating High Temperature Synthesis", *Properties and Applications of Silicon Carbide*, InTech, chapter. 18, pp. 411–425, 2011.
- [19] W. Chen, Z. Fan, A. Dhanabalan, Ch. Chen & Ch. Wang, "Mesoporous Silicon Anodes Prepared by Magnesiothermic Reduction for Lithium Ion Batteries", *Journal of The Electrochemical Society*, Vol. 158, pp. 1055-1059, 2011.
- [20] S. Niyomwas, "The effect of carbon mole ratio on the fabrication of silicon carbide from SiO<sub>2</sub>-C-Mg system via self-propagating high temperature synthesis", *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, Vol. 30, pp. 227-231, 2008.

## ۶- پی نوشت

- [1] Mesoporous